26. アルキルハライドの運轉具性體 W. F. Edgell 及 G. Glockler, J. Chem.

Phys., 9, 375-6 (1941).

アルキルハライドに廻轉異性體の存 することは箕 験上異論なき事實である。 その存在する梨ボシュー トランス型であるか否か問題である。

CH₃Br に於ける C-Br 特有の振動は603 cm⁻¹ で あり, C₂H₃Br では566 cm⁻¹ である. C₃H₂Br 以上: のものでは 廻轉異性體に 基く 二つの 振動数を 生ず る.

Call-Br	563 cm ⁻¹	648 cm ⁻¹
C4II9Br	563 <i>*</i>	642 *
C ₅ H ₁₁ Br	564 🔌	642 *
C. IL.Br	563 🐐	647 *

同様な現象が Cl 及び [の置換盤によつても 見られ る. との振動は CH₂X 悲に隣つてゐる 炭素原子に 直接に結合する置換基によつて定まると云へる. CH₂X-CH₂Y 型に属する分子が CH₂X 基と CH₂

Y 基の間に一定の方向性を持つのは1―2二クロルエ タンに於ける闘係と同様である。

現在ニハロゲン化エタンにはシスートランスの災 性體が存すると一般に考へられてゐる。 トランス型 の存在は水島, 森野研氏の偈體ハロゲン化エタンに 於て唯一の異性體として存在が確定せられた。

Kohlrausch 等の如くシス型をもう一つの異性機 とするとその安定性を説明するのが困難である、事 ろ波機としては C。型(CH.X 基がトランス型より 120°週轉した型)を取る方が従来の結果と一致する ラマンに於て 1600cm⁻¹ 以下の偏光線の数 はトラン ス2、シス9、C。6である、貨際見出 されてゐるのは 8であるからトランスと C。型をとればよく合ふ、電 子蛆折像及び雙柄子測定の結果 よりそのポテンシャ ル曲線はトランス構造から120°の所に二つ 極少が生 ずる。又電子廻折 よりすれば Cl-Cl の 距離は44± 0.1及び3.2±0.1A となり、トランス及び C。型の理論 値とよく一致する。

との型の分子には何れもシス型の 異性酸の存在が 證明し得ない。 エタンすら 捩れ型 Dol 型がよい様 に思はれる。 二ハロゲン化エタンでは液駅では恐ら く捩れ型 (トランス, Co 型)のみ存在してゐる。 エ チレンハライドの 場合 もトランスCo 構造が 存する

錄

抄

ものと思はれる。 尚 CH_eX CH_eR 型のアルキルハ ライドは CH_eX 悲の振動に騙して ニハロゲン 化エ タンと同様な暴動をするから CH_eX 悲が CH_eR 悲 に騙して定まる回轉の位置は トランス型とそれより 120^o回轉した型を持たねばならぬ。 (石川)

27. 電子衝撃によつて沃度蒸氣中に 生ずる貧オイン

R. Buchdahl, J. Chem. Phys., 9, 146-52 (1941).

著者は Lozier に依ると同様な裝置を 川ひて沃度 蒸氣 (6-10⁻⁵—3-10⁻⁴mmHg) に電子を衝突させその 衝突電子の速度を種々に (0—7V) 變じて生ずる負イ オンの量及びその運動のエネルギーを測定した。

 $\sigma i = \frac{Ii}{Ie \cdot No \text{ of molecules/cm}^3 \times d \times f}$

d は電子の通過する距離, f は装置の構造に關す る定数, li 及び le はイオン及び電子電流。

oi は衝撃電子速度の變化に伴つて變化し0.4 V に て最大となり、1.75及び2.5V にて極大を示す(3.5V は不明瞭). このイオンボ J₂+e→I⁻+I の反應から 出來ることは I⁻ が持つ運動のエネルギーが 上の反 聴から得られる運動エネルギーの 理論値とが一致す ることから判る. これから沃度の 電子親和力を求め ると3.0±0.2V が得られ從來の値と一致する. 上の 反応の最大收損は8×10⁻⁴と考へられるが上式のすが 確定出來ぬから決定値ではない.

沃度分子の解離エネルギーはその原子の 電子規和 力よりも小さいから l₂+e→I⁻+I+ (Ekin) は零速度 電子によつても可成のイオンを生 ずるが零から電子 速度の増加と共にその枚量を増し 0.4V にて 最大と なる、その後急に減少する. l₂ ポテンシャル曲線の 底から l₂⁻ ポテンシャル曲線の 垂直距離が 0.4V に 相當するから上の轉移が起る.

1.75V 及2.5V の極大は 沃度分子と電子の 非彈性 術実によるものと考へられる。 沃度分子の電子研究 による直接職起によると考へるよりは寧ろ I⁺ 及び I^{*} のポテンシャル曲線の交點が2.5V 附近にあるの で I_±+e→I⁻+I^{*} の如き反應が起つてイオン生成量 の減少がこの附近で妨げられて極大が出来 るものと



No. 3

抄

(石川)

想像される.

28. 無聲放電によるオゾン發生 W. H. Otto 及 W. H. Bennett, J. Chem.

Phys., 8, 899-903 (1940).

反應等器は重鉛引きの鐵板裂 のものでその容量は 18立方呎,この内に放電電極として 天の三種類を使 用した。第一は 0.005時の 貫直なタングスケン線に 1/4時の貫着の支持を添へたもの,第二 0.001時のタ ングステンの針金の小片を針金に直角に並べて多数 取付けたもの,第三は 0.0009時の ニッケル 合金線 にロヂウムを鍍金したものを用ひた。對電極は二箇 用ひてその面が空氣翼を形作る 膝に排列して放電に よつて生じたオソンを放電による電氣風によつて混 合せられる様に工夫した。カスは空氣を用ひて適當 な温度を興へ埃を除いた。生じたオソンは 0.0369立 方呎を取り出して K1 を通じて定量した。

毎アンペアに毎秒生ずるオゾンの遺生量

(ミリ瓦にて)

	ニッケルにロジウム鍍金せるもの	タングステ ン	タングス テン
2. +	1.05	1.20	1,95
1	2.85	5.70	16.5
. +	1.13	1.58	24
2	5.25	7.80	29.1
2. +	1.13	1.65	2.48
		$\frac{2}{2} + \frac{2}{2} \frac{1}{2} $	\star

上の表より次の四つの事が判る.

- 放電面の曲率半徑が少なればオソン 發生速度 は少である。
- ロヂウム被膜の作用は酸化酸の 生成を妨げて 曲率半徑を減少する。
- 3) 生成速度は放電電極が負極の方が正極よりも 大である。
- (3)の現象は小なる針金より大なる針金の場合によくおこる。

又16500菌の 電子の中ただ 一つの電子が オソン分子を作ることになる.

他の金燭を放電様林として用ふると 鋼鐵ではタン グステンと同様に酸化膜が 田來て被膜は鋳色を呈す る。 自金では放電部分に正負何れの種でも稠密な眞 黒な破膜が生ずる。 この生成が大であるとオゾン發 生速度も大である。 酸化被膜は絶極層として働きこ れが破壊すると局部的な違光を生ずる。 37

101

10

空氣中に 無摩放電 をすると 電秘の 周りに 電離鞘 (ionizing sheath), オゾン化鞘 (ozonizing sheath) 及 び附着鞘 (attachment sheath)の三つの部分が中心よ り外部に向つて上の順序に出來る。今個に負電縁を 考へるに電離鞘は電極面に生ずる 少数電子が電場に よつて突進して電離を起し雪崩狀に (avalanch) 桁加 して10-10 Coulomb 位迄に達する部分である. 夫の オゾン化範にてはかくして 出來た電子が周囲の正イ オンの作用によつてその速度が12.5V以下に減じて 酸素分子と衝突して0+0,→0,の反應がおこる部分 である。この外側に電子が分子狀酸素を勵起して塗 に分子に附着して 分子狀酸素イオンを作る部分があ る、これを附着鞘と云ふ。 電極が正の場合は電離鞘 及びオゾン化精の幅が狭くて 充分電子が電離をさせ ないし 又分子を解離出来ないのでオゾンの生成量が 少い, 俳しこの場合生ずる正イオンが鞘の厚さを粉 すし乂解離がおこるときに勵起がおこつて 紫外線を 出して酸素分子を分解するので生成量は少し増す. 一般に負電極の針金の太さが増すと鞘の幅も増すの でオゾンの収録は大になる。 正電極の場合は電極の 太いものは電極附近の電場が弱いから 衝突によつて よく解離が起る. (石川)

29. プロパンのカドミウム光増感反应 E. W. R. Steacie, D. J. LeRoy 及 R. Potvin, *J. Chem. Phys.*, 9, 306—14 (1941).

エタン、プロバン、ブタンの原子駅水素との反應, 水銀滑速反應等は既に著者等により登扱されたが, 本研究はプロバンの水銀滑速反應(本誌14.抄錄71(昭 15))に購職してなされたものである。

使用した光の波長は主として 3261Å で之は Cd (5 Ph) の原子に相當する。反應方法は前報と同様で一 定址のプロバン (歴力約10cm) を反應管に循環せし め,後に生成物を分析する。水素及びプロバンによ るカドミウム3261Å の吸軟は本實驗に於ては殆ど完 全である。

反應物質がプロバンのみの場合。反應の初速度は 4×10⁻⁶ mol/sec で、之は量子生成率約0.6に當る。 プロバンの脈が高くなると反應速度は腰に無關係に なるが、低脈の場合は速度は減少する。之は恐らく 光の吸收が不完全なためと思はれる。 温度の影響は 265⁹-310°C 迄は殆どないが、之より低温になると 速度は減少する。 之は反應管中の Cd の蒸気が不充

鋂

抄

'分となるためであらう.

生成物の中の瓦斯駅のものは水素、メタン、ブタ ンより成る・反應初期に於て水素、メタン、生成量は 時間に比例する。末期に到つて水素の生成は豊分急 速になるが之は二次反應が増すためである。生成物 の中 -80°Cにて液駅のものの量はプロパンの消費量 と非常によく平行してゐる。これは此等の生成が反 塵の一次的な部分にあることを示す。その成分は主 として、ヘキサン (2-Me-pentane, 3,2-di-Me-butane) であるが、之に少量のペンタン、ヘブタンを混じて 居る.

反應物質がプロパンと水素なるときも反應速度は 同じである-又瓦斯駄生成物も大體同じであつて, 反應時間が短い時は生成物は殆ど同じであるが,長 くなると,水素の量が少くなり,メタンの量が多く なる。此の場合も液駄生成物の量はプロパン消費量 とよく平行して居る.その成分も大體よく似てひる が,此の場合にはヘキサンが少くなり,高沸點の生 成物が多くなる.

以上の結果と, 水銀柏感反応の結果と比較して第 一次過程は

 $Cd(^{3}P_{1})+C_{3}II_{8}=CdH+C_{3}II_{7}$ $CdH=Cd(^{1}So)+H$

水業の存在するときは Cd(³P₁)+H₂=CdH+H

主なる第二**次反應**は H+C₃H₈=C₃H₇+H₂

 $2C_3H_7 = C_6H_{14}$

なる水素とヘキサンの生成反應であるが、 その外に **次**の如き反應も考へられる・

 $H+C_{3}H_{7}=C_{2}H_{5}+CH_{3}$ $CII_{3}+C_{3}H_{8}=CH_{4}+C_{3}H_{7}$ $CH_{3}+C_{3}H_{7}=C_{4}H_{10}$ $2C_{2}H_{5}=C_{2}H_{10}$ $C_{2}H_{5}+C_{3}H_{7}=C_{5}H_{12}$ $C_{3}H_{7}=C_{2}H_{4}+CH_{3}$ $R+C_{2}H_{4}=alkyi radical$

(R: H, CH₃, C₂H₅,.....)

水素の存在する場合。 反應時間が長くなると一次 的に出來たプタン 又はペンタンと水素とが反應して メタンの量が多くなる。

へキサンはプロビル基の再結合により生ずるが、 此の場合二次水素の結合は弱いから 生成するのはイ ップロビル基である。生ずべき2,3-di-Me-butane 及 び2-Me-pentane の量を統算して見ると實驗値に大疊 一致する。又ヘプタンは hexyl 悲とメチル基とより 出来ると思はれるが、同様に此の際出来るのはイン ヘキシル基である。かふる強想と分析結果とはよく 一致する。

水銀柏感反應の場合の生成物は殆ど水素とヘキサ ンのみであつたが、本實驗では其の外にメタン、ブ タン、ベンタン等も相常出來る.此の事は CdII は HgH よりも安定で、500°C では相常長い生命(約 10^{-;} sec)を有して居るために

CdH+**C**₃H₈=CH₄+C₂H₅+Cd なる反応が容易に起るためであると想像される・ (長谷川)

30. アセトンの高温光分解とプロパンに 對するメチル自由基の作用

A. O. Allen, J. Am. Chem. Soc., 63, 708-14 (1941).

アセトンは2000〜3200 Å の光でメチル基, アセチ ル基を生じて分解することが知られてゐる。 此の様 にして 作つたメチル基 とプロパン とを 反應 せしめ た。 光源には高壓水銀燈を用ひ辞的方法にて反應せ しめ, 反應生成物を分析した。

先づアセトンのみの 光分解を 520° K~620° K で 行つた。その生成物中の永久瓦斯はメタンと一酸化 炭素であると考へられる。CH4/CO なる比はアセト ンの歴には無關係で, lng (CH4/CO) と温度の逆数と は直線關係にある事から, 7100 cal なる活性化エネ ルギーが得られる。480°~577°K にて行つた宜録で は生成物中の全炭化水素のモル数と一酸化炭素のモ ル数とは等しくなる。 流動法により反應生成物の最 を多くして分析した結果。メチルエチルケトンが出 冰る准を確認した。又メタンの生成は器壁に附着す る物によつて影響を受ける。

次にプロパンとアセトンの比が 2:1 である如き瓦 斯を用ひて530°~610°K で實驗した。生成物中には 水素及び不飽和炭化水素は認められなかつた。

以上の結果より次の如き機構が考へられる。

 $CH_3COCH_3 + h\nu = CH_3 + COCH_3 \qquad k_0$

 $COCH_3 = CO + CH_3 \qquad k_1$

 $COCH_3 + CH_9 = C_2H_6 + CO$

 $CH_3 + CH_3COCH_3 = CII_4 + CII_4COCH_3 = k_1$

物理化学の進歩 Vol. 15n

No. 3

抄

CH₃+CH₂COCH₃=C₂H₅COCH₃ メタンと一酸化炭素の比を B とすれば、定常決態に 於て(1-B)/S²=k₀k₂/k₁k₅ となり、従つて B はアセ トンの腰に無闘保となる・生じた アセトニル基が器 墜に附着して、之がメチル 基と反応してメチルエチ ルケトンを作る。アセトン光分解の際に出來る少量 のプロパン、ブタンは第一に出來たエタンにメチル 法が作用してエチル基を生じ、之がメチル表、アセ チル基又はエチル基自身と反応して 生ずるものと考 へられる・断くの如くして得られる全反応の中にあ る一酸化炭素のモル数と 全炭化水素のモル数とは等 しい・

プロパンを加へた場合にはメチル基は プロパンに 作用してプロピル基を作るが、 之は不飽和化合物を 作らずに、 メチル基义はアセチル基と反應してブタ ンを作る。分解して自由基を作るアセトンの量と、 その中のプロパンと反應するものとの比をとり、 そ の對数と温度の 連数とを plot すると 直線關係を得 る. 之より5200 cal なる活性化エネルギーを得る。 此の事よりメチル基とプロパンとの 反應は均一反應 であつて、不均一反應なるメチル基と アセトンとの 反應と共に進行する事が判る。

Smith 及 Taylor の言へる如くプロパンの二次水 素は、一矢水素よりも結合が弱いためにインプロピ ル基を生じ、従つてイソブタンを生ずる. 分析によ ればイソブタンとブタンとの比は 2:1であるので、 之より 一交水素と 二次水素の 活性化熱の差は 2060 cal なる結果を得た. 此の値は Taylor 等の値とよく 一致してゐる. (長谷川)

有機反應熱 X. 環式オレフインの臭化反應熱 M. W. Lister, J. Am. Chem. Soc., 63, 143-9 (1941).

不飽和化合物の水素化又は臭素化の 反應熱を測定 して,それと分子構造との關係を求めんとする. 熱 量計は液相系反應に用ひられる容量500 cc. の頸の長 い球形の Dewar 瓶にて, 自会抵抗震吸計により Mueller 型橋を用ひて温度を測定する。 種々のオレ フインの四曜化炭素溶液約450 cc. と再蒸溜した臭素 3~4 gr. 入のアンプールを熱量計に入れ,アンプー ルを割つて反應せしめる。オレフインが臭素の約 3 倍過剰になつてをり, 反應器造び反應液の熱客量は種間 鑅

103

反應前後に二度測定する。 オレフイン及びその二臭 化物の四癭化炭素への溶解熱は同様に () 接熱量計に より測定した。

更にこれらの溶液内反應の薄定値より 氣相中の値. を知る気に, 各物質の蒸發熱を知る必要がある。 石 英發條マノメーターにより 種々の温度に於ける蒸氣 際(0.1 mm.より100 mm.の間)を調定して Trouton 川より27°Cに於ける蒸發熱を計算した。それより氣 相系の反應熱として次の値が得られた。 尚, 前報に て得た水素化反應熱 (82°C) を舉げてをく。

反	應	反應熱-1113000 (cal./mole)	(水素化) 反應熱)
Cyclopente	ne+Br ₂ -+C ₅ IL ₈	Br ₂ 28610	26915
Cyclohexen	e+Br. -•Csll	33630 Br2	28592
Cyclohepte	ne+Br.	Br. 30440	26386
Cycloöcten	e+Br. -+C ₈ Ĭl ₁ .	Br ₂ 29310	23525
n-I Leptené-	1+Brg -+C7II,	Br ₂ 30240	
n-Butene-1	+Brg C4II6	Br ₂ 28900	

即ち cyclohexene が最大の反應熱を有する。これ らの結果より反應物の構造を論じてゐる。 例へばー 般に附加反應に repulsion 説と attraction 説とがあ るが、上の結果は前者の説に都合がよい。 父、水素 化反應と臭化反應との反應熱より 環ズパラヒインの 置換反應の熱を求めてゐる。

 $C_5H_{10} + Br_2 \rightarrow C_5H_8Br_2 + H_2 + 1942$ cal.

C₆H₁₂+Br₂→C₆H₁₀Br₂+H₂+5292 cal. この差 3350 cal は次の構造變化に伴ふエネルギー變 化を示すと述べてゐる。



32. 酸素分子の熱的活性化

H. D. Hagstrum & J. T. Tate, Phys. Rev., 59, 509-13 (1941).

酸素中での電子衝撃過程の研究中に、著者等に依 り發見された事であるが、O。に對する CO。、COII。

と学の進歩 Vol. 15h (1941)

Vol. XV

抄

○ 節の割合が、電子發生源たるタングステン議僚の 温度に依て著しく左右される傾向がある。[Phys. Rev., 57、1071 (1940)]. これは加熱金屬議僚の上で 何か觸媒反応の起る話であらうと考へられるので之 を更に追求して見たのである。 -

タングステン機体を使ふと、電子源や幅煤として 作用する 火でなく、WO3 が田永るので 之を避ける 気に電子源としては低温度で電子を 發生する酸化物 被複織体をマススペクトロメーター内に用ひ,その 何管に高温度觸媒として自金纖体を併用した。電子 衝撃室は10⁻⁴mml lg の程度に保つ様に O2を流した。 そして自金纖條の温度を色々變へた時に、O2⁺, CO2⁺ CO⁺ 或は H2O⁺ 等の各イオン相互の割合がどの程度 に影響されるかをスペクトロメーターで 観察し様と するのである。 勿論賞験前に自金纖條は充分高温度 で排氣されてある。

その結果わかつた事は、 自金の温度が1280° K に 達する差は O₂+ の量は一定値を示すが、この温度を 越すと低下し始め、 1740° K では元の46%にもなつ て了ふ.それと同時に、CO₂、CO 及び H₂O の割合は 特加し始めるのである.この傾向は自金繊酸を含む 例管を液體空氣で冷却しても依然として現れる. 但 しこの時、 H₂O⁺ と CO₂+ の増加は現れない.そし てこの現象は速績的に見られるのではなくて、 或時 間の後には O₂, CO₂, CO 及び H₂O の割合は一定値 を示すに重るのである. O₂ の低下が元の半分になる 標な條件の時には、これは數分間の程度で定常狀態 になるのである.

これは、自金織係表面で O₂ が活性化吸着を行ひ、 これが活性化された分子として 蒸発し 硝子壁に吸着 して居る H や C を含む物質と反応して、 CO₂ CO 或は H₂O になる岱であらうと 考へられた。 その根 嫁として次の様な事が郵行られて居る。

(1) 賞職前に豫めよく排氣してあるから, この現 象が自金繊統中に含まれた 不純物の笃とは思はれない.

(2) 自会表面上で O. が他の IL や C を含む蒸氣 と反應したとも考へられない。 そんな蒸氣があれば マススペクトロメーターに現れる筈である。 文 O.の 中に含まれた不純物の賃ならばもつと 持續的に現れ る筈である。

ヽ(3) 次に考ふ可きは 耐子焼上の 不純物 であるが 耐子壁は豫め加熱排気處理がしてあるから 残留吸着

1.6

物質がありとすれば 餘程蒸氣脈の小さなものに違ひ ない.

久に、○ が自金面上で活性化される型式として 次の様な三つの可能性が考へられる。

(1) 準安定活性状態として¹4g及び¹5g*の二種 が考へられる。これは夫々1.0及び1.6 Voltsに相常す る状態である。

(2) 更に一層高い準安定振動狀態として O. の解 離點(5.082 Volts)に近い駅憩が考へられる。

(3) O. が解離して原子釈となる場合(5.082Volts) これらの状態の 中比較的低温では(4)の場合が最も 起り易いわけである。 液體空氣に浸けても像り變ら ぬし持續的でもない所から見ても 原子駅の酸素が出 米で居るとは考つられない。

白金鐵鉄の温度が充分高い時には(2)の場合が最 も起り易いと云ふ事が推定出来る。

尚 II₂ に就ても同様の 實驗が行はれ, 白金織族の 温度が約2200°K 附近から II₂+ の減少が現はれると 云ふ結果を得て居る。 そしてこれは II₂ が白金表面 で原子県に解離する事に依るものであると|推定され た。

(附記:低照酸素中で自金線を加熱する時酸素が 減少して CO₂ でCO が出て来ると云ふ現象は, 既に佐々木、 平木園氏の研究 [日化61, 419(昭 15)]に於て認められ, それは, グリーズ蒸氣の 炭化物と酸素とが自金線上で反應する事に 起因 する事が推定されて居るのであるが, 上記報文 に於ては, 斯う云ふ事に就て全く考慮が拂はれ て居ない).

(後藤)

2

33. 金屋オスミウム構媒上の吸着と窒素 同位元素交換

W. R. F. Guyer, G. G. Joris & H. S. Taylor, J. Chem. Phys., 9, 287-94 (1941).

我に著者等は鐵及びタングステン上に 於ける窒素
の同位元素交換反應に就いて報告した (本誌14, 抄数
10(昭15))が、今回は¹ Haler がアムモニア合成腸跳
としてよい結果を得た ○s 觸媒に就いて吸消及び交
換反應を研究した。

Os-觸媒は ammonium osmium chloride を水素氣 泳中で300°C に熱して作った。

水素の吸消は83°K より573°K 迄測定した。 此の

104

物理化学の進歩 Vol. 15n (1941)

No. 3

吸育は活性化吸剤であり、83°K に於てはその一部 は van der Waals 吸剤である、窒素の van der Waals 吸着も 80°K より次第に減少する、吸着は 350°K で極小となり、再び428°K で極大となるが、 此の増加は窒素の活性化吸消に歸せられる、窒素の 80°K に於ける等温線より Emmett 及 Brunauer の 方法により1元の Os 觸媒の表面積は30.8平方米とな るが、此の中1 氣壓に於ける'活性化吸剤に有效な面 積は極大點(428°K)に於ても4%に過ぎない、273°~ 573°K の温度範疇に於て窒素の吸着は水素の吸剤の 10%よりも小である、かいる Os-觸媒は 673°K に於 て絶えず Sinter して居る。

窒素の同位元素交換反應は前報と同様な方法で行 はれた. 250°C~300°C の範圍で行つた 動果より活 性化熱21.0~21.8 kcal を得たが、酸素によって被毒 した觸媒に對して26.1 kcal なる値を得た. 280°C に 於ける反應速度は窒素の懸には 無關係であって水素 によって著しく抑制され、3%の水素が存在すればそ の影響が現れれ、 50%以上存在すれば反應は起らな い。

アムモニアの分解は 300°C に於て交換反應の少く 共6倍の速度であり,その生成物は 3H₂: N₂ なる和 成である.

以上の結果より窒素交換反應の 速度は察素脱着の 速度より退い事が判る. 此の際の窒素の吸着する活 性中心は少く,吸着せる窒素原子は非常に離れてゐ るので,その移動が速度を決定する. アムモニア分 解の場合はその吸着が大となるために移動距離が小 さく従つて分解速度が大となると考へられる.

Fe の場合とは反對に,交換反應は少量の水素によ つて抑制されるが,之は水素の吸着が大なるために 窒素の移動が妨げられるためと思はれる.

此の外に反應は窒素原子の移動ではなく, 窒素分子の吸着-脱着に 依り起 るとしたり, 又窒素分子の 吸着は原子への解離は完全ではなく, 結合手の一部 であるとする考へも可能であるが, 未だ決定的な事 は言へない。

交換反應の活性化エネルギーが Feの場合が50 kcal であるのに比べて、 Os の場合は22 kcal であるのは Os と N との結合が Fe よりも 遊に不安定 である水 が考へられ、 事賞 Fe の窒化物は存在する事は知ら れてゐるが、Os には存在しない.

(長谷川)

34. オルソパラ水素轉移に對する網媒 としての困難自由基

J. Turkevich 2 P. W. Selwood, *J. Am.* Chem. Soc., 63, 1077-9 (1941).

低温に於けるオルソバラ水素の轉移は、吸着され た水素に對する常磁性觸媒の不均一磁場の影響に歸 せられて居る。 固機の自由基は、その自由な値和さ れて居ない原子質のために 常磁性を有する筈である から、 此の様なものが果して觸媒作用を有するか否 かを檢し様とするのが本研究の目的である。 觸媒と して用ひたのは a, a-diphenyl-β-picrylhydrazyl で, 之は製法が比較的簡單であり、 固體歌態で非常に解 離し、 尚容集中で安定である。

a, a-diphenyl-β-picrylhydrazyl 及びその hydrazine の **常磁車を講定した結果**, a, a-diphenyl-β-picrylhydrazyl は液體空氣の溫度では常磁性であり, Πつ完 全に自由基である事が知った。酸化亜鉛は極く 償か 常磁性である。

自由基は液體空氣の温度では水素の吸消をなさな いが、酸化温鉛は相當な吸着量を示す。

オルソバラ水素轉移は自由基及び酸化亜鉛共に極く 使得であるが、 此の兩者を等量によく混じたもの は速かなる轉移を示す。

此の事よりオルソバラ水素轉移の不均一接觸反應 には2の要素。即ち不均一破場(今の場合は自由基に より生ずる)及び水素が此の 磁場に 長時期接觸する 事(健化電動上への van der Waals 吸着) が必要な 事が判る. (長谷川)

35. 水素電極の過電壓と電氣二重層の構造

G. E. Kimball, S. Glasstone Z A. Glassner, J. Chem. Phys., 9, 91-6 (1941).

電極反應への絶對反應速度論の應用により、イオ ン放電又はイオン化過程の比速度として次式が與へ られた.(本誌14,60,15,49 紹介参照)

S=(kT/h)exp(- dF*/RT)exp(a V P/RT).....(1) 茲に V を電極に於ける實際のポテンシャルとすべき か, 單に過電歴とすべきか, は問題である。 例へば 水素イオンの放電に際しては 實驗的に過電歴を用ふ べきであり, 他方簡單に運輸的には全ポテンシャル とすべきである。 本論文ではこの問題を電極表面に 二種の異なる電気二度層が存在すると 假定して解決

105

6

物理化学の進歩 Vol. 15n (1941)

106

1.

1.

抄

してゐる。今電秘より遠い方のイオン層を"溶液層 solution layer,"内方のイオン層を"吸消層 adsorbed layer"と呼ぶ。溶液内のプロトンは先づ溶液層に達 し、第一のエネルギー障礙を越えて吸消層に移り、 第二のエネルギー障礙を越えて"電極層 electrode layer"に達するとする。しかして電極層に於けるプ ロトンは吸消水漆原子又は吸消水分子の一部として 存在するのであらう。プロトンのかえる層を通る際

2

のポテンシャルエネルギー面は間の如くである.



Solution Adsorbed Electrode Layer Loyer Layer

(尚,溶液と溶液層、及び電極層と電極との間のポテ ンシャル 差は 非常に 小と考へる。 しかして 著者等 は (1) 式とか ⊾る 假定より理論的に次の如き結果を 得た。

非常に薄い酸性溶液に注つてゐる 秘く低態の水素 瓦斯で覆はれた電秘では吸着層での 水素イオン濃度 が非常に小であるから, 電秘ボテンシャルは溶液層 と電秘層とより成る二重層により作られる. この際 V₁ 及び V₂ は余ポテンシャル V に夫々 <u>d₁</u>

d₁+d₂ (d₁は溶液層と吸消層と、 d₂は吸着層と電 d₁+d₂ (d₁は溶液層と吸消層と、 d₂は吸着層と電 極層との距離)を乗じたものである。 若し溶液の水 素イオン濃度火は水素瓦斯の 懸力の増加により吸着 層での水素イオン濃度が増して、 より以上の増加に 抗する様になれば、 溶液の水素イオン 濃度は V₁ に のみ火水素懸力の 増加は V₂ にのみ 影響する様にな る.

以上は平衡の場合であるが、 電流が流れる場合に はポテンシャル分配は大のいづれかにより定まる.

速度決定が溶液層より吸着層 へのプロトン移行にあ るか,又は吸着層より電極層への移行にあるか,前 者を吸着支配,後者を放電支配と呼ぶ、理論的に放 電支配であると云ふ精論になつた。即も速度は過電 腰により決定されるもので全ポテンシャルによるも のでない.又,不衡電壓は主として液溶層と吸着層 との間に生ずるが,過電壓は吸着層と電極層との間 に生ずるものである.

更にかゝる二つのエネルギー障壁の 性質に就いて

Vol. XV

論じ, かゝる陸壁はプロトンが或る水分子より他の 分子への移行によるものであらうと述べてゐる。 (水波)

36. 水素過電壓の理論

J. A. V. Butler, J. Chem. Phys., 9, 279-80 (1941).

Eyring, Classtone 及 Laidler (*J. Chem. Phys.*, 7, 1053 (1939),前項参照)は水素過電歴に絶対反應速 度論を應用して次の結論を得た。活性化エネルギー の差がなければ水素瓦斯の 發生速度は水素イオン震 度に無關係であるから, 速度決定過程は水素イオン よりも寧ろ"水分子"を含む。その理由は速度式

I=I₀e^{QVF/RT}, I₀=Be^{-ΔII0/RT}(1) にて恒数 B が水素イオン激度に無關係であり、與へ られた過電歴では、活性化エネルギー dI^{I0} により電 達が決定される事による。しかしこの数には種々の 不明確な點も多く、又著者等の主限とする B の代 りに

 $I_0 = B^{I} [I[F]e^{-\Delta H \phi/RT} \dots (2)]$

に於ける恒數 B¹ に對しても考へる必要がある。

或る水酸イオン濃度の 隙基性溶液に於て水素イオ ン濃度は 温度により 變化 するから 魔基性溶液 では AELの決定に補正を加ふべきである。 AEL の見かけ の値は

$$\left(\frac{\mathrm{d}\log I_0}{\mathrm{d}(\mathrm{I}/\mathrm{T})}\right)_{\mathrm{V}} = -\frac{\mathrm{d}\mathrm{I}\mathrm{Ia}^0}{\mathrm{R}}$$

で表はされ水素イオン濃度の 一定なる場合に比べ<mark>次</mark> の係数だけ異なる。

 $\frac{d \log [H^+]}{d(I/T)} = \frac{d \log Kw}{d(I/T)} = -\frac{d Hw}{R}$

d(I/T) ー d(I/T) ー R 茲に Kw は水のイオン 化恒数, dilw はイオン化熱 である. dil⁰=dlla⁰-dHw にて, dHw=13.6 Kcal として, 種々の金屬に對する0.2 N-H₂SO₄ 及び 0.2 N-NaOH 溶液に就いて B 及び B¹ を求めたるに B¹ の方がよき恒数を示した. 更に Kimball や Bowden 説に関し少しく論じてゐる. (水渡)

37. 額料亞麻仁油懸濁液の透電恒数

F. Wachholtz & A. Franceson, Kolloid-Z., 92, 75-93, 158-69 (1940).

液體とその中に分散されてゐる固體との 間の界面 現象を発明するための一方法として透電的手段を用 ひ,種々の類料の運麻仁油懸濁液に就いて, 系全體

物理化学の進歩 Vol. 15

No. 3

としての透電恒数が, 系を構成せる各成分の透電恒 数と如何なる關係にあるかを調べた。液體系の透電 恒数はそのまょ普通の容量測定法により, 固體頗料 の透電恒数は浸液法によつて得られた。

面料の含有率が50%に達する程の 高濃度のものに
なると、系全體の偏極が各成分の偏極の算術利とし
て表はされると云ふ (低濃度の場合には大して問題
にするに及ばない) 關係からの偏倚が著しく 大とな
る、一例として普通の鉛丹の場合を示したのが第一
圖である。



DK Werte für gewöhnliche Bleimennige

a) gemessen $\times \times \times$

b) berechnet nach der arithmetische Mischungsformel

著者等は son Fray が比慮尊度の計算に営って用 ひた様な模型により,立方形の顔料粒子が個々に分 れて液體の中に分散されてゐる場合と互に籾状に連 額して存在する場合とに分けて計算してみると, 賞 調値は各の場合の二つの限界曲線の一つに一致する か丁度兩者の中間に來る。例へば第二圓甲は二種の



DK-Werte gemessen an : zinkeiweiss "grob" O O O zinkeiweiss "fein" × × × berechnet :

a) obere Grenze für Typ Ⅰ (son Frey)
 b) untere Grenze für Typ Ⅰ (son Frey)
 亜鉛華乙は二種の鉛丹の場合を示す。 濃度透電恒数
 曲線の形は類料粒子の特性に關係 してゐるものゝ漆

抄



DK-Werte gemessen an: gewöhnlicher Bleimennige OOO Solotiermennige × × × berechnet

a) Obere Grenze für Typ 📱 (son Frey)

b) Untere grenze für Typ 📱 (son Frey)

である.

次に茲に得られた設度透電恒数曲線を基礎にし、 分散粒子の形を考慮し、分散相の設度と系全體とし ての透電恒数の間の關係を示す Bruggeman, Lichtenecker 並に Rother 及び Wiener の諸式を比較考察 してみると Wiener の式が最もよく適合する。但し 針狀單斜晶系のクロム酸鉛の 懸濁液に就いてはよく 賞厳らない。

要するに餌料と距離仁油との二成分系に於て各成 分の混合の類型と顔料粒子の形状とをよく吟味せず に普通の混合の式をそのまゝ用ひることは非常に危 險な結論に到達し易いことになる. (山北)

38. 銀ゾルの二重層

II. R. Kruyt 发 II. I. van Nouhuys, *Kolloid-Z*, 92, 325—42 (1940).

貴金燭ゾルミセルの二重層に開して 現在行はれて ある見解は完全に一致 してゐない. Pauli は例へば 稀薄な苛性曹達水溶液中に散亂された 銀ゾルの二重 層は次の如き構造を有するものと考へた.

Ag AgO-+Na+

これに對して Ueerwey 及び de Boer は負電荷を有 する炭素粒子が COO・原子園によつて解腸されると 云ふ Kruyt や de Kadt の考へとは別に Trumki の 示した如く粒子の表面には, 酸素の一分子層が存在 してゐて酸素電秘の様な琴動をし, H+ 及び OH- が ポテンシャルを決定するイオンとして 働いてゐると 云ふ説を立てた。

107 -

3理化学の進歩 Vol. 15n (1941)

Vol. XV

٩.

108

Ø.

,著者等は銀ゾルを使って

i) 如何なる狀況の 下に安定なる 銀ゾルを生成す るか(解腸)

ii) 普通の銀ゾルが植々の電解質に 對してどんな 反應を示すか.

と云ふ二點に着目して上述の二つの 見解の何れが妥 當なるかを検討した。

著者等の研究結果から引用される 結論に従っば錆 イオンによる解腸は分散媒の構成に 闘騎したポテン シャルで定められ, 大の如き平衡状態によつて示さ れる,

Ag⁺+2011⁻⁺AgO⁻+2H₂O (int. Flüssigkeit) AgO⁻(int. Flüssigkeit)⁺AgO⁻ (Teilchen) Ag⁺+2Cl⁻⁺AgCl⁻ (int. Flüssigkeit) AgCl⁻(int. Flüssigkeit)⁺AgCl⁻ (Teilchen)

着イオンの解聴は熱力學的に表はされる ポテンジ ヤル曲線でうまく説明出来る。しかも此のポテンジ ヤル曲線は、銀粒子のミセル間の液體に對して使業 でなしに銀のポテンジヤルを 假定してゐる事情を考 へに入れねばならない。(山北)

> 39. 非水懸濁液の粘度 E. W. J. Mardles., *Tranis. Farad. Soc.*, 36, 1007---17 (1940).

1) 積々の有機液體中に同種固體を分散させたも

١

2) 同種有機液體中に種々の因體を分散 させたもの.

以上二つの場合に就て濃度の廣い範圍に互り、 胚力 可變型指度計を用ひて粘度を測定した。

脳洞液の粘性系数 η と分散媒の 粘性系数 n との 比 n/m は n の値の大小によつて多少變化すること が解った. グリセリンの様な, 粘性の大なる液體で は, n/m の値が比較的大きく n- ヘキサンの様な粘 性の小なる液體では n/m が比較的小さい.又比の 比は温度の上昇と共に低下し, 迷には1に近付く.

低粘度の液體中に於ける石湿の 懸濁液に就ては低 濃度に於て Einstein の粘度式 y=y0 (1+2.5V) (但 し V は分散粒子の部分比容) 極續油中に於けるカオ , リン並に酒精中に於ける雲母に就いては、低濃度に 於ても、その粘性系数が Einstein の理論値の4倍に なる。

新 ŦI

T. B. Smith, Analytical Processes : A Physico-Chemical Interpretation. Pp. viii+470. (London : Edward Arnold and Co., 1940.) 18s. net.

P. Arthur, Lecture Demonstrations in General Chemistry. (International Chemical Series.) Pp. xvi+455. (New York and London ; McGraw-Hill Book Co., 1940) 26s.

L. J. Bercher, Physical Chemistry, A Brief Course with Laboratory Experiments. Pp. 429. (New York: Prentice-Hall, 1940.) \$ 3.00.

J. Jeans, An Introduction to the Kinetic Theory of Gases. Pp. 311. (Cambridge: University Press, 1940.)

A. Seidell, Solubilities of Inorganic and Metal Organic Compounds. Third Ed. Vol. I. Pp. 1698. (New York: D. Van Mostrand Co., 1940.) \$ 12.00.

J. A. Stratton, Electromagnetic Theory. Pp. 615. (New York : McGraw-Hill Book Co., 1940.) \$ 6.00.